



**INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA**

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE
(Rule 74 Of The Patents Rules)

क्रमांक : 011141185
SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 383670
आवेदन सं. / Application No. : 201611022219
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 29/06/2016
पेटेंटी / Patentee : 1.DR. SATYENDRA PAL 2.DR. KENNETH E.
GONSALVES 3.DR. SUBRATA GHOSH 4.DR. C.P.
PRADEEP et al. et al. et al.
आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.DR. KENNETH E. GONSALVES 2.DR. SUBRATA
GHOSH 3.DR. C.P. PRADEEP 4.MR. GURUPRASAD
REDDY 5.DR. SATINDER K. SHARMA 6.DR. PAWAN
KUMAR 7.DR. SATYENDRA PAL

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित HIGHLY SENSITIVE MAPDSM-MAPDST BASED RESISTS TECHNOLOGY FOR NEXT GENERATION LITHOGRAPHY APPLICATIONS नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 29th day of June 2016 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled HIGHLY SENSITIVE MAPDSM-MAPDST BASED RESISTS TECHNOLOGY FOR NEXT GENERATION LITHOGRAPHY APPLICATIONS as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 29th day of June 2016 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 03/12/2021
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 29th day of June 2018 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 29th day of June 2018 and on the same day in every year thereafter.